

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17283-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 07.09.2020

Ausstellungsdatum: 07.09.2020

Urkundeninhaber:

TASCON Gesellschaft für Oberflächen- und Materialcharakterisierung mbH

mit ihren Standorten

Mendelstraße 17, 48149 Münster

Otto-Volger-Straße 19, 65843 Sulzbach/Ts.

Prüfungen in den Bereichen:

physikalisch-chemische Analyse der chemischen, elementaren und molekularen Zusammensetzung von Oberflächen, Grenzflächen, oberflächennahen Schichten, komplexen Schichtsystemen, Spurenverunreinigungen und oberflächennahem Volumenmaterial einschließlich der Lateral- und Tiefenverteilung an Festkörpern, Querschnittsflächen, Pulvern, Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und Lacken mittels Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS) und Photoelektronenspektroskopie (XPS/ESCA); Bestimmung der Rauigkeit von Oberflächen mittels optischer Profilometrie

Innerhalb der mit ** gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Modifizierung sowie Weiterentwicklung von Prüfverfahren gestattet. Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Innerhalb der mit *** gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17283-01-00

Die Prüfverfahren sind mit den nachfolgend aufgeführten Symbolen der Standorte gekennzeichnet, an denen sie durchgeführt werden:

MS = Münster

MTK = Sulzbach/Ts.

1 Bestimmung der chemischen, elementaren und molekularen Zusammensetzung von Oberflächen, Grenzflächen, oberflächennahen Schichten, komplexen Schichtsystemen, Spurenverunreinigungen und oberflächennahem Volumenmaterial einschließlich der Lateral- und Tiefenverteilung an Festkörpern, Querschnittsflächen, Pulvern, Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und Lacken mittels Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS) **

VA-OG-AM-ToF-SIMS-Spektrenakquisition / 3 2017-02/ 3	Chemische Charakterisierung von Oberflächen mit der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS): Spektrometrie	MS
VA-OG-AM-ToF-SIMS-Imageakquisition / 3 2017-02	Chemische Charakterisierung von Oberflächen mit der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS): Imaging	MS
VA-OG-AM-ToF-SIMS-Tiefenprofilakquisition / 2 2017-02	Chemische Charakterisierung von Oberflächen mit der Flugzeit-Sekundärionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS): Tiefenprofilierung	MS
VA-OG-AB-ToF-SIMS-Quantifizierung-von-B-in-Si / 2 2017-02	Quantitativer Nachweis von Bor in Silizium (ToF-SIMS)	MS

2 Bestimmung der chemischen, elementaren und molekularen Zusammensetzung von Oberflächen, Grenzflächen, oberflächennahen Schichten, komplexen Schichtsystemen, Spurenverunreinigungen und oberflächennahem Volumenmaterial einschließlich der Lateral- und Tiefenverteilung an Festkörpern, Querschnittsflächen, Pulvern, Partikeln, Fasern, Flüssigkeiten und Lacken mittels Photoelektronenspektroskopie (XPS/ESCA) **

VA-OG-AB-XPS-Messen- und Auswerten-Spektroskopie / 2 2017-02	XPS-/ESCA-Messungen und -Auswertungen: Spektroskopie	MTK
VA-OG-AB-XPS-Messen-und Auswerten-Imaging / 0 2017-02	XPS-/ESCA-Messungen und -Auswertungen: Imaging	MTK